# ドレスト光子による誘導放出を利用した

波長1.3~1.9µm帯の非冷却型Si受光素子

Uncooled Si infrared photodetector for 1.3-1.9 µm-wavelength using stimulated emission by dressed photons

日亜化学工業(株)<sup>1</sup>, ドレスト光子研究起点<sup>2</sup>

<sup>O</sup>門脇 拓也<sup>1</sup>, 川添 忠<sup>1</sup>, 大津 元一<sup>2</sup>, 佐野 雅彦<sup>1</sup>, 向井 孝志<sup>1</sup>

Nichia Corporation<sup>1</sup>, Research Origin for Dressed Photon<sup>2</sup>

°Takuya Kadowaki<sup>1</sup>, Tadashi Kawazoe<sup>1</sup>, Motoichi Ohtsu<sup>2</sup>, Masahiko Sano<sup>1</sup>, Takashi Mukai<sup>1</sup>

E-mail: takuya.kadowaki@nichia.co.jp

## 1. はじめに

近年、ドレスト光子(DP)技術により Si 結晶を 用いた非冷却型の赤外受光素子の実現可能性が 提案されている[1]。従来の Si の受光素子は遮断 波長  $\lambda_c$  (1.1 $\mu$ m)以上の赤外光には感度を持たない が、この素子では入射光により生成された DP が 励起したコヒーレントフォノンを介して電子が バンド間励起されるため、 $\lambda_c$ 以上の長波の光にも 感度を持つ。

前回の講演で我々は DP を使った Si 発光素子 を作製し、その EL 発光波長がバンドギャップエ ネルギーEgに依存せず波長 1.3 µm、2.0 µm に明 瞭なピークを持つことを示した[2]。またその発 光過程がバンド間の光学フォノン準位に起因し ていることを明らかにした。本講演では、この発 光の逆過程に相当する受光特性を評価したので 報告する。

#### 2. 素子作製

Fig.1(a)に作製した素子の外観を示す。n型のSi 基板に B 原子をイオン注入し p 型に変換した後、 電極を形成し、1 mm 角に素子化した。作製した 素子に DP を効率よく発生させるため、ドレスト 光子フォノン援用アニール(DPP アニール)と呼 ばれる製作法を用いた。これは電流注入によるジ ュール熱アニールとレーザー光照射(波長 1.3 µm) による誘導放出に起因する冷却とを同時に行い、 最適な B 原子分布の自律的形成を促すものであ る。その結果、作製された素子は Eg ではなく照 射光エネルギーに支配される受発光(光子ブリー ディング)が可能となる。今回、効率的に DPP ア ニールを行うために新たに Fig.1(b)に示す基板構 造を用いた。すなわち、n型のSi基板上に5Ωcm の高抵抗層をエピタキシャル成長することで、pn 接合付近に局所的にジュール熱が発生する構造 とした。これにより、基板の余剰熱による不要な ドーパント拡散を低減でき、従来より効率的な B 原子分布の形成が可能であると考える。



Fig.1 (a)Photographic profile of Si-photodetector. (b) Schematic of the substrate.

#### 3. 結果と考察

作製した Si 素子に波長 1.3 µm、1.55 µm、1.9 µm のレーザーをそれぞれ照射し、室温での I-V 特性の変化から受光感度を測定した。Fig.2(a)は 注入電流密度と波長1.55 µmの光に対する感度と の関係である。電流密度の増加に伴い感度が増加 する傾向が見られる。これは順方向電流注入によ り DP を介した誘導放出が生じ、キャリアが吸わ れることにより、I-V 特性の変化が大きくなるた めである。Fig.2(b)は波長と感度との関係である。 図中の赤線は本素子に順方向電流密度 20 A/cm<sup>2</sup> 印加時の感度特性を示す。また、比較のために黒 線は先行研究(順方向電流密度 10 A/cm<sup>2</sup>)[1]、破線 は市販の Si-PD (S3590:浜松ホトニクス社製)の 感度特性を示したものである。本素子は  $\lambda$  以上 の光に対して大きな感度を持つことが確認され る。特に波長 1.9 μm での感度は室温で 2×10-3 A/W であり中赤外領域でも非常に高い感度を持 つ可能性を示した。また、先行研究に対しても波 長 1.3 µm での感度特性が上回る結果を得た。こ れは前述した DPP アニールを効率的に行うため の素子構造の精密化による結果であると考える。

以上のように、複数フォノンが励起に関わるの で熱励起電子の寄与はなく、冷却不要の室温動作 が可能となる。これは既存の InGaAs 等の化合物 半導体に対する優位性である。今後はドーパント 濃度および DPP アニール条件の最適化すること で、より長波長の赤外光受光を目指す。



Fig.2 (a) Relationship between current density and sensitivity at a wavelength of 1.55  $\mu m.$  (b) Relationship between wavelength and sensitivity.

### 【参考文献】

[1] H. Tanaka, T. Kawazoe, and M. Ohtsu, *Appl. Phys. B*, **108** (2012) pp.51-56

[2] 門脇拓也,川添忠,大津元一,第 67 回応用物理学 会春季学術講演会(2020 年 3 月), 14p-B309-16